

CVI装置 CI-4500



CVI装置CI-4500は糸状のカーボン繊維を1200～1500℃に加熱して、CVD法により、カーボン膜やSiC膜を含浸させることのできる実験用CVI装置です。

CVI装置 CI-4500 仕様

| | |
|-----------|---|
| ○膜種 | SiC/C |
| ○炉体サイズ | φ30mm×1000mm |
| ○炉体材質 | SUS316 |
| ○基板形状 | φ8mm×6000本/束 |
| ○到達圧力 | ×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時 |
| ○排気速度 | ×10 ⁻¹ Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時 |
| ○加熱温度 | 1500℃ |
| ○圧力コントロール | 自動 |
| ○ガス種 | SiCl ₄ /CH ₄ /N ₂ /H ₂ |
| ○電源 | DC電源 150V 4.5kW 1台 |
| ○真空排気系 | 油回転ポンプ:260L/min メカニカルブースターポンプ:50m ³ /h |
| ○真空計 | ピラニ真空計/バラトロン真空計 |
| ○ユーティリティ | 電気: AC200V三相30kVA 冷却水: 10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア: 0.5MPa以上 |